

SJ

中华人民共和国电子行业军用标准

FL 5971

SJ 20714 — 1998

砷化镓抛光片亚损伤层的 X 射线双晶衍射试验方法

Test method for sub - surface damage of gallium arsenide polished
wafer by X - ray double crystal diffraction

1998 - 03 - 18 发布

1998 - 05 - 01 实施

中华人民共和国电子工业部 批准

中华人民共和国电子行业军用标准

砷化镓抛光片亚损伤层的 X 射线 双晶衍射试验方法

SJ 20714—1998

Test method for sub - surface damage of gallium arsenide polished
wafer by X - ray double crystal diffraction

1 范围

1.1 主题内容

本标准规定了砷化镓抛光片亚损伤层的 X 射线双晶衍射试验方法。

1.2 适用范围

本标准适用于经过化学、机械单面和双面抛光的砷化镓晶片亚损伤层的定性测量。

2 引用文件

GJB 1926 - 94 砷化镓单晶材料规范。

3 定义

本章无条文。

4 一般要求

4.1 测量大气条件

- a. 环境温度： $23 \pm 5^{\circ}\text{C}$ ；
- b. 相对湿度： $\leq 70\%$
- c. 大气压力：86 ~ 106kPa

4.2 测量环境要求

测量实验室应无振动，不允许存在电磁干扰；并保证一定的洁净条件。无腐蚀性气体。